Webinaire Groupe métrologie, inspection





RéNIL



Réseau National de la Lithographie par

Nano-Impression



<u>cea</u> leti

28 Mai 2024

Les intervenants

Cécile Chevalier

Yoann Blancquaert

Api Warsono

• Yves Jourlin

• Elliot Chevalier

Olivier Dubreuil

Institut des Nanotechnologies de Lyon

CEA-Leti

CEA-Leti

Laboratoire Hubert Curien

Université Montpellier/CEA-Leti

CEA-Leti

Agenda

- 1. Introduction générale, présentation du webinaire Cécile Chevalier
- 2. Présentation générale du groupe de travail métrologie RéNIL Yoann Blancquaert
- 3. La lithographie NIL au Leti Api Warsono
- 4. Métrologies pour les mesures dimensionnelles et d'overlay Yoann Blancquaert
- 5. Wafer scale submicron optical grating for the picometre measurement of aberrations and stitching errors in step and repeat cameras Yves Jourlin
- 6. La mesure de défectivité Elliot Chevalier
- 7. La mesure épaisseur par ellipsométrie Olivier Dubreuil
- 8. Actions à venir Cécile Chevalier / Yoann Blancquaert





Réseau National de la Lithographie par NanoImpression

Contact:

renil_cogouv@groupes.renater.fr

COMMUNAUTE

ANIMATION SCIENTIFIQUE

EXPERTISES Technologiques, fondamentales, Simulation

Process Full wafer Roller-type Hybrid...

Moule

Master: soft-NIL NIL termique Multi-échelles...

Matériau

Résines, matériau fonctionnels, chimie...

Outils

R&D Indstriels et startup Applications spécifiques

Métrologie,

inspection Moules, impressions...

Théorie

Rhéologie « filling » « curing » Démoulage... Sciences surface et interface, mécanique des fluides...

Simulation

Rhéologie « filling » « curing » Démoulage Déformation ...